



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک $CuFeO_2$ تهیه شده به روش محلول شیمیایی

حافظه ممقانی و مجید قناعت‌شعار

آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده - لایه نازک $CuFeO_2$ روی زیرلایه کوآرتز با استفاده از روش محلول شیمیایی و تکنیک لایه‌نشانی چرخشی تهیه شد و خواص ساختاری و الکترواپتیکی آن پس از بازپخت در گاز آرگون در دمای $750^\circ C$ مورد بررسی قرار گرفت. فازهای تشکیل شده با استفاده از پراش اشعه ایکس مشخص شدند. تراگسیل در بازه‌ی مرئی و گاف انرژی مستقیم $CuFeO_2$ با استفاده از نتایج طیف تراگسیلی به ترتیب 3.2 eV و $30\text{--}55\%$ بدست آمد. با استفاده از اندازه‌گیری اثر هال، رسانایی الکتریکی و چگالی حامل‌های بار به ترتیب $3.87 \times 10^{-2} \text{ S/cm}$ و $1.4 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ بدست آمد.

کلید واژه: $CuFeO_2$ ، لایه نازک، لایه‌نشانی محلول شیمیایی، نیمرساناهای اکسیدی شفاف

Structural and optical properties of $CuFeO_2$ thin films produced by chemical solution deposition

hafezeh Mamaghani and majid ghanaatshoar

Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983963113, Tehran, Iran

Abstract- transparent conductive $CuFeO_2$ thin films were deposited onto quartz substrate using chemical solution process and then thermally annealed in argon at $750^\circ C$. The derived thin films were characterized by x-ray diffraction. The transmission at visible region and direct optical band gap of the $CuFeO_2$ thin films were 30-55 % and 3.2 eV, respectively. The Hall effect measurement showed that the electrical conductivity and carrier concentration of the films are $3.87 \times 10^{-2} \text{ S/cm}$ and $1.4 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, respectively.

Keywords: $CuFeO_2$, thin film, chemical solution deposition, transparent oxide semiconductor

۱- مقدمه

تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که روش سل-ژل، روش بسیار مفید و مطلوب برای رشد لایه نازک‌های دلافوسیتی است [۳]. CuFeO_2 تهیه شده با روش محلول شیمیایی، نسبت به دیگر روش‌های لایه‌نشانی رسانندگی و تراگسیل بالاتری از خود نشان می‌دهد. در این مقاله از روش محلول شیمیایی با تکنیک لایه‌نشانی چرخشی برای ساخت لایه‌های نازک CuFeO_2 استفاده شده است و خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی نانولایه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- روش انجام آزمایش

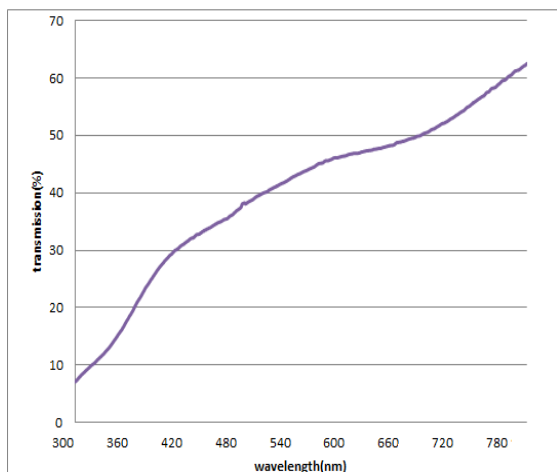
از مس استات ۱ آبه (با جرم مولی ۱۹۹/۶۵ گرم بر مول) و آهن نیترات ۹ آبه (۴۰۴ گرم بر مول) به عنوان ماده‌ی آغازی استفاده می‌کنیم. از ۲-متاکسی اتانول (با جرم مولی ۷۶/۰۹ گرم بر مول) و مونواتانول آمین به ترتیب به عنوان حلال و پایدار کننده بهره می‌بریم به طوری که غلظت محلول ۰/۲ مولار باشد [۳]. پس از آماده‌سازی محلول، لایه‌نشانی با آهنگ ۲۵۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۱۵ ثانیه روی زیرلایه‌ی کوآرتز انجام شد. برای تبخیر حلال و خارج نمودن ترکیبات آلی، لایه‌های تهیه شده به مدت ۲۰ دقیقه در کوره هوا در دمای ۴۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد تحت فرآیند خشک‌سازی قرار گرفتند. این فرآیند ۳ بار برای دستیابی به ضخامت مورد نظر تکرار شد. در هر بار لایه‌نشانی تقریباً به ضخامت ۷۵ نانومتر دست می‌یابیم. در پایان نانولایه‌ها به مدت یک ساعت در کوره خلأ در دمای ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد در حضور اتمسفر گاز آرگون و فشار زیر ۱۰ میلی بار قرار گرفتند.

بازپخت این نمونه در هوا نمی‌تواند انجام شود چون منجر به تولید Cu^{2+} می‌شود و در نتیجه فاز CuFe_2O_4 فاز غالب خواهد بود. اما در حضور گاز آرگون دو گذار $\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ و سپس $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^+$ اتفاق می‌افتد، در حالی که در هوا گذار دوم رخ نمی‌دهد. در نتیجه پارامتر دمای بازپخت نیز در سنتز CuFeO_2 مهم است و تشکیل آن به دمای بالا نیاز دارد.

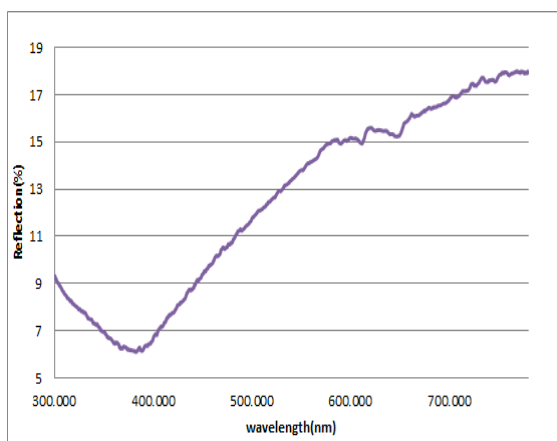
خواص ساختاری نمونه با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس (ساخت شرکت Bruker با گسیل خط طیفی CuK_α) و خواص الکتریکی آن با استفاده از چیدمان آزمایشگاهی پروب چهار نقطه‌ای و اثر هال مورد مطالعه قرار گرفته است. طیف تراگسیلی و انعکاسی نمونه نیز با

نیمرساناهای اکسیدی شفاف به دلیل داشتن گاف انرژی پهن و رسانندگی بالا توجه زیادی را به خود معطوف کرده‌اند. این نیمرساناها کاربرد فراوانی در صنایع اپتوالکترونیک، حسگرهای گازی، نمایشگرهای صفحه تخت، دیوده‌های نورگسیل، سلول‌های خورشیدی و غیره دارند [۱]. با وجود کاربردهای گسترده نیمرساناهای اکسیدی شفاف، به دلیل نبود نیمرساناهای اکسیدی شفاف نوع p، کاربردهای کمی از آنها برای ساخت ادوات فعال نوری گزارش شده است.

دلافوسیت‌ها اکسیدهای سه‌تایی با فرمول AMO_2 هستند که A یک کاتیون یک ظرفیتی مانند Cu و Ag و M فلز سه ظرفیتی مانند Al، Fe، In و Cr است [۲]. اولین نیمرسانای اکسیدی شفاف نوع p، ساختار دلافوسیتی CuAlO_2 بود که لایه نازک آن در سال ۱۹۹۷ با روش لایه‌نشانی پالس لیزری گزارش شد که با شناسایی آن امکان ساخت ادوات نوری شفاف فراهم شد. CuFeO_2 اولین دلافوسیت معدنی است که در سال ۱۸۷۳ توسط فریدل کشف شد و برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ با روش واکنش حالت جامد توسط سولر و همکارانش ساخته شد. گسترش نیمرساناهای نوع p راه را برای یافتن کاربردهای جدید برای نیمرساناهای اکسیدی شفاف باز کرده است که این مهم به تنهایی با نیمرساناهای نوع n امکان‌پذیر نیست [۳]. CuFeO_2 نیمرسانای نوع p است و با رسانندگی نسبتاً بالا در ساخت سلول خورشیدی شفاف، دیوده‌های نورگسیل، نیمرساناهای مغناطیسی رقیق و غیره کاربرد دارد [۴]. روش‌های متعددی برای ساخت لایه نازک CuFeO_2 وجود دارد که از آن جمله می‌توان به روش لایه‌نشانی پالس لیزری، بخار شیمیایی، کند و پاش و محلول شیمیایی اشاره کرد [۵]. روش محلول شیمیایی در مقایسه با روش‌های دیگر آسان، مقرون به صرفه و سریع است و به دستگاه‌های خلأ نیاز ندارد و همچنین قابلیت کنترل ضخامت لایه‌های نانومتری را دارد. در این روش کیفیت و خواص الکترواپتیکی لایه‌ها به پارامترهایی مانند غلظت محلول، ناخالصی وارد شده به ساختار، دمای خشک‌سازی و دمای بازپخت بستگی دارد [۶].



شکل ۲: طیف تراگسیلی لایه نازک CuFeO_2 .



شکل ۳: طیف انعکاسی لایه نازک CuFeO_2 .

اوربیتال‌های $(\text{Cu } 3d + \text{O } 2p)$ و $(\text{Cu } 3d_z^2 + 4s)$ به ترتیب نوار ظرفیت و نوار رسانش دلافوسیت CuFeO_2 را شکل می‌دهند. در گذار الکترون از $(\text{Cu } 3d + \text{O } 2p)$ به $(\text{Cu } 3d_z^2 + 4s)$ گاف انرژی ماده طی می‌شود [۶]. لبه‌ی جذب در ۲۷۵ نانومتر ظاهر می‌شود که متناظر با تحریک الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش است. از لبه جذب برای تعیین گاف انرژی استفاده می‌شود.

ضریب جذب را می‌توان با استفاده از قانون بیر-لامبرت بدست آورد که به صورت زیر است:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln\left(\frac{I_0}{I}\right) \quad (1)$$

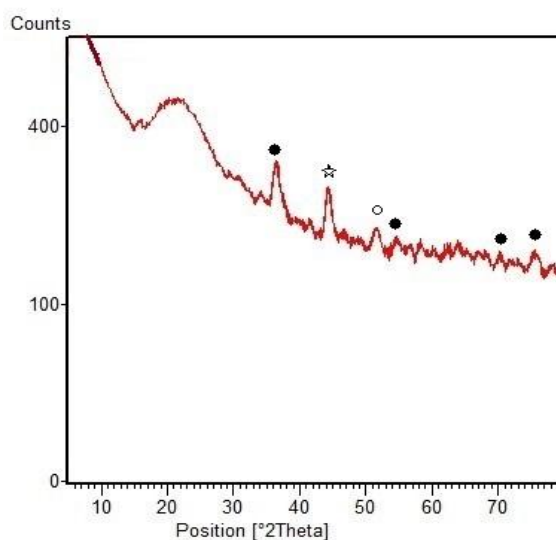
در این رابطه d ضخامت لایه و T تراگسیل نور را نشان می‌دهد. با استفاده از فرمول تاک که با رابطه‌ی زیر بیان می‌شود:

استفاده از طیف سنج Avantes مدل ۳۶۴۸ تعیین شده‌اند.

۳- نتایج و بحث

الگوی پراش اشعه ایکس از لایه نازک CuFeO_2 در شکل ۱ نشان داده شده است. هما‌نطور که ملاحظه می‌شود فاز اصلی CuFeO_2 مطابق $(\frac{75}{61}, \frac{64}{01}, \frac{51}{80})$ ، $2\theta = (22/29)^\circ$ تشکیل شده است. به علت پایین بودن دما برای کامل شدن واکنش، علاوه بر فاز CuFeO_2 ، دو فاز اضافی CuFe_2O_4 در $2\theta = (36/55)^\circ$ و CuO در $2\theta = (44/45)^\circ$ ظاهر شده‌اند. با توجه به غالب بودن فاز CuFeO_2 و عدم دسترسی به کوره خلأ با دمای بالاتر به همین مقدار حرارت‌دهی اکتفا کردیم.

طیف تراگسیل لایه نازک CuFeO_2 در شکل ۲ نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که در بازه‌ی مرئی ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر تراگسیل نمونه $30\% - 55\%$ است. تراگسیل این نمونه کمتر از CuCrO_2 و CuAlO_2 است که دلیل آن گذار اوربیتال‌های $d-d$ آهن است [۶]. در شکل ۳ طیف انعکاسی CuFeO_2 بدست آمده است. از این طیف برای تعیین ضخامت و ضریب شکست نمونه استفاده می‌شود که به ترتیب برابر با ۲۲۰ نانومتر و $1/74$ است.



شکل ۱: طیف پراش اشعه ایکس CuFeO_2 (●) → CuFeO_2 ، (○) → CuFe_2O_4 ، (*) → CuO .

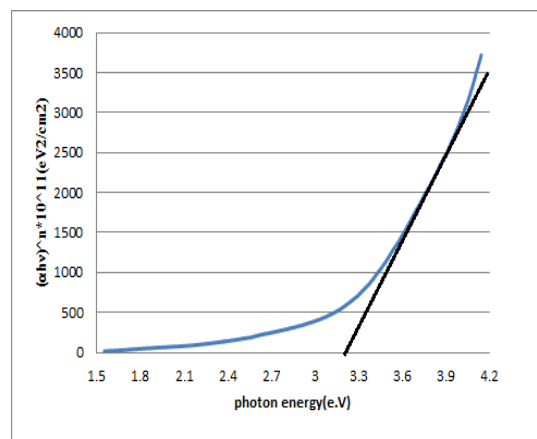
CuFeO₂ برابر با $3/87 \times 10^{-2}$ S/cm خواهد بود. رسانندگی الکتریکی با استفاده از روش محلول شیمیایی در مقایسه با روش‌های فیزیکی تحت خلأ بیشتر است [۳].

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله نانولایه CuFeO₂ به روش محلول شیمیایی و تکنیک لایه‌نشانی چرخشی بر روی زیرلایه کوارتز تهیه شد. خواص ساختاری و الکترواپتیکی نمونه مورد بررسی قرار گرفت. پراش اشعه ایکس، فاز اصلی CuFeO₂ را به همراه دو فاز اضافی نشان می‌دهد. تراگسیل CuFeO₂ در بازه مرئی ۳۰-۵۵٪ و گاف انرژی مستقیم آن ۳/۲ eV بدست آمد. با استفاده از نتایج اثر هال، رسانندگی CuFeO₂ برابر با $3/87 \times 10^{-2}$ S/cm است. نتایج نشان می‌دهند که لایه نازک تهیه شده با روش محلول شیمیایی تراگسیل و رسانندگی بالاتری نسبت به دیگر روش‌های لایه‌نشانی دارد. از این رو این روش، روش مناسبی برای ساخت لایه نازک CuFeO₂ است.

مراجع

- [1] K. Tonooka, K. Shimokawa, O. Nishimura, *Properties of copper-aluminum oxide films prepared by solution methods*, **Thin Solid Films**, 411 (2002) 129-133.
- [2] V. Jayalakshmi, R. Murugan, B. Palanive, *Electronic and structural properties of CuMO₂ (M = Al, Ga, In)*, **Journal of Alloys and Compounds**, 388 (2005) 19-22.
- [3] H. Y. Chen, J. H. Wu, *Transparent conductive CuFeO₂ thin films prepared by sol-gel processing*, **Applied Surface Science**, 258 (2012) 4844-4847.
- [4] L. Zhang, P. Li, K. Huang, Z. Tang, G. Liu, Y. Li, *Chemical solution deposition and transport properties of epitaxial CuFeO₂ thin films*, **Materials Letters**, 65 (2011) 3289-3291.
- [5] Z. Deng, X. Fang, S. Wu, Y. Zhao, W. Dong, J. Shao, Sh. Wang, *Structure and optoelectronic properties of Mg-doped CuFeO₂ thin films prepared by sol-gel method*, **Journal of Alloys and Compounds**, 577 (2013) 658-662.
- [6] H. Y. Chen, J. H. Wu, *Characterization and optoelectronic properties of sol-gel-derived CuFeO₂ thin films*, **Thin Solid Films**, 520 (2012) 5029-5035.
- [7] D.S. Kim, S.J. Park, E.K. Jeong, H.K. Lee, S.Y. Choi, *Optical and electrical properties of p-type transparent conducting CuAlO₂ thin film*, **Thin Solid Films**, 515 (2007) 5103-5108.
- [8] D. H. Choi, S. J. Moon, J. S. Hong, S. Y. An, *Impurity dependent semiconductor type of epitaxial CuFeO₂ (111) thin films deposited by using a pulsed laser deposition*, **Thin Solid Films**, 517 (2009) 3987-3989.



شکل ۴: نمودار گاف انرژی CuFeO₂.

$$(\alpha hv)^2 = A(hv - E_g)^n, \quad (2)$$

محاسبه‌ی گاف انرژی لایه‌های نازک CuFeO₂ را انجام دادیم. در این رابطه E_g گاف انرژی، hv انرژی فوتون و A و n ضرایب ثابت هستند [۶، ۷]. برای گذارهای مستقیم، n برابر ۲ و برای گذارهای غیرمستقیم، n برابر ۱/۵ است. با رسم نمودار (αhv)² برحسب انرژی فوتون (hv) و تعیین محل تقاطع آن با محور انرژی می‌توان مقدار گاف انرژی را بدست آورد. در شکل ۴ گاف انرژی مستقیم نمونه نشان داده شده است که برابر با ۳/۲ eV است.

رسانندگی در این ترکیب به دلیل حضور اکسیژن اضافی و یا کمبود فلز در ساختار شبکه‌ای است. حضور اکسیژن اضافی در نقاط فرعی شبکه به عنوان تله‌ای برای گیراندازی الکترون‌ها عمل می‌کند. در اثر این فرآیند در نوار ظرفیت حفره‌ای ایجاد می‌شود. این حفره عامل رسانندگی CuFeO₂ است [۸]. تحرک‌پذیری و چگالی حامل‌های بار با استفاده از اثر هال اندازه‌گیری شد. مقاومت ویژه لایه نازک با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\rho = 1/en\mu. \quad (3)$$

در این رابطه n چگالی حامل‌های بار و μ تحرک‌پذیری حامل‌ها است. برای بهبود خواص الکتریکی و افزایش رسانندگی σ=enμ می‌توان از یک کاتیون دو ظرفیتی به عنوان ناخالصی استفاده کرد [۵]. نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری اثر هال نشان می‌دهد که تحرک‌پذیری و چگالی حامل‌های بار به ترتیب برابر با ۱/۷۳ cm²/V.s و ۱/۴ × ۱۰^{۱۷} cm^{-۳} است. به این ترتیب، رسانندگی